

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分
 【発行日】平成 17 年 6 月 23 日 (2005.6.23)

【公開番号】特開 2003-203767 (P2003-203767A)
 【公開日】平成 15 年 7 月 18 日 (2003.7.18)
 【出願番号】特願 2002-1052 (P2002-1052)
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 5 B 33/10
 C 2 3 C 14/04
 H 0 5 B 33/12
 H 0 5 B 33/14

【F I】

H 0 5 B 33/10
 C 2 3 C 14/04 A
 H 0 5 B 33/12 B
 H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】
 【提出日】平成 16 年 9 月 27 日 (2004.9.27)
 【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】請求項 2
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【請求項 2】

電極材料層間に発光材料層を挟持してなる発光素子が設けられた複数の画素を、基板上に配列形成してなる表示装置の製造方法であって、
蒸着マスクの一面側に蒸着源を配置し、前記蒸着マスクの他面側に前記基板を配置し、蒸着マスクの各開口部から、前記基板における第 1 方向に配列された複数の画素を一括して露出させた状態で、当該第 1 方向と直交する第 2 方向に、前記蒸着マスクと前記基板とを前記蒸着源に対して相対的に移動させることで、前記基板上の各画素に前記発光材料層の蒸着パターンを形成することを特徴とする、

表示装置の製造方法。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】請求項 5
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【請求項 5】

蒸着マスクの一面側に蒸着源を配置し、前記蒸着マスクの他面側に基板を配置し、当該蒸着マスクと基板とを前記蒸着源に対して相対的に移動させることで、前記基板上の各画素に発光素子を構成する材料層の蒸着パターンを形成する際に用いる蒸着マスクであって、
 前記基板における一方向に配列された複数の画素を一括して露出させる開口部を備えたことを特徴とする蒸着マスク。

【手続補正 3】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0014
 【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 1 4 】

また、本発明の表示装置の製造方法は、電極材料層間に発光材料層を挟持してなる発光素子が設けられた複数の画素を、基板上に配列形成してなる表示装置の製造方法である。本発明においては、蒸着マスクの一面側に蒸着源を配置し、前記蒸着マスクの他面側に前記基板を配置し、蒸着マスクの各開口部から、前記基板における第1方向に配列された複数の画素を一括して露出させた状態で、当該第1方向と直交する第2方向に、前記蒸着マスクと前記基板とを前記蒸着源に対して相対的に移動させることで、前記基板上の各画素に前記発光材料層の蒸着パターンを形成することを特徴としている。